

## К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КВАЗИРАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВАКАНСИЙ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗОНАХ

*B. С. Солдатов, Е. М. Слюсаренко, С. Ф. Дунаев*

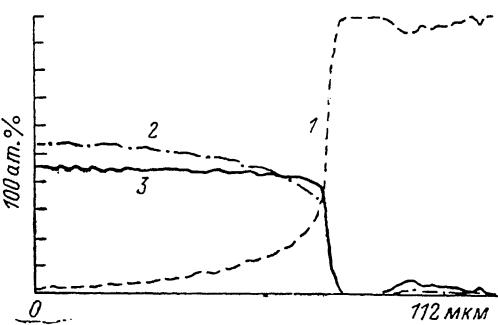
При исследовании процессов взаимной диффузии в системе Mo—Nb—V в диффузационных парах типа Mo+ сплав (Nb, V) было обнаружено накопление ниобия и ванадия в молибдене на некотором расстоянии ( $\sim 10$ — $15$  мкм) от сформировавшейся диффузационной зоны. Данная область представляет собой слой шириной около 10 мкм с максимальным содержанием ванадия до 10 ат.%, а ниобия — до нескольких процентов (см. рисунок). Хотя в исходном сплаве концентрация ванадия может быть меньше, чем ниобия, в области накопления его содержание всегда выше.

Наблюдаемое распределение концентраций, полученное на рентгеновском микроанализаторе, многократно воспроизводилось на образцах, полученных в различных режимах и с различными временами отжига, с различным соотношением концентраций ниобия и ванадия в сплаве, негомогенность которого не превышала 0.2 ат.%, причем этот эффект не является следствием каких-либо поверхностных явлений, так как он воспроизводился и после многократных срезов с образцов слоев толщиной до 1 мм.

Подобное «туннелирование» атомов ванадия и ниобия через прослойку молибдена с образованием обогащенной ими области вне диффузационной зоны не может быть объяснено общезвестными механизмами, управляющими перераспределением концентраций компонентов в диффузационных зонах. Эффект Френкеля (порообразование) наблюдается в диффузационных зонах только со стороны, содержащей быстродиффундирующй компонент, т. е. со стороны ниобий-ванадиевого сплава. Эффект Киркендалла, наблюдающийся во всей диффузационной зоне, также не дает оснований предполагать возникновение подобных флюктуаций. Тем не менее наличие между диффузационной зоной и концентрационной флюктуацией прослойки молибдена, практически не содержащей ванадий и ниобий, указывает на то, что и «туннелирование» атомов ванадия и ниобия через эту прослойку осуществляется на уровне концентраций вакансий.

Авторы полагают, что наблюдаемый эффект связан с проявлением еще одного общего механизма восстановления квазиравновесной концентрации вакансий в диффузационных зонах — механизма генерации и рекомбинации вакансий путем изменения объема микроЭластей диффузационной зоны. Причиной возникновения такого механизма являются неравенство скоростей осаждения различных атомов на дефектах решетки и неравные скорости доставки атомов к дефекту, работающему в качестве источника вакансий. В результате состав системы в области источника вакансий может существенно отличаться от состава окружающей матрицы, при этом накапливаются более подвижные атомы, занимающие меньший объем, чем атомы матрицы.

В наблюдаемом нами случае наиболее подвижные атомы ванадия и ниобия глубоко проникают в молибден по вакансационной подсистеме. В результате в диффузационной зоне со стороны молибдена число вакансий уменьшается, тогда в этой области инициируются процессы, приводящие к генерации вакансий. Как правило, генерация вакансий осуществляется путем осаждения части атомов на дефектах решетки (дислокациях, границах зерен и т. д.) или, если учесть предложенный механизм, образованием кластеров, обогащенных атомами с меньшим атомным объемом. Мольный объем для молибдена составляет 9.39, для ниобия 10.84 и для ванадия 8.56 см<sup>3</sup>/моль. Для того чтобы объем кластера, содержащего ванадий и ниобий в молибденовой матрице, был меньше объема, занимаемого тем же числом атомов молибдена, содержание ванадия в кластере должно превосходить содержание ниобия, так как атомный



Концентрационные распределения в диффузионной паре состава Mo+сплав (55 % Nb + 45 % V).

1 — молибден, 2 — ниобий, 3 — ванадий.

объем нюбия больше, чем молибдена, а атомный объем ванадия меньше. Предполагая аддитивность атомных объемов при расчете объема области, получаем, что должно быть  $C(\text{Nb})/C(\text{V}) < 0.36$ . Расчеты по экспериментальным данным в области концентрационной флуктуации для диффузионной пары состава  $\text{Mo}+(55\% \text{ Nb}+45\% \text{ V})$  дают значение  $C(\text{Nb})/C(\text{V}) = -0.32 \pm 0.05$ , т. е. наблюдается удовлетворительное согласование.

Таким образом, обнаруженный эффект представляет собой проявление общего механизма восстановления квазиравновесной концентрации вакансий в диффузионных зонах путем образования кластеров меньшего объема.

Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова

Поступило в Редакцию  
21 апреля 1988 г.

04; 11

Журнал технической физики, т. 59, в. 6, 1988

## ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ИОНОВ, БОМБАРДИРУЮЩИХ КАТОД ПРИ ИОННО-ПЛАЗМЕННОМ РАСПЫЛЕНИИ

*В. А. Вольяс, Е. К. Гольман, А. Г. Зайцев, А. Б. Козырев, Д. Чекай*

Теоретические модели расчета энергетических спектров частиц, распыляющих катод диодной распылительной системы [1-3], требуют определения функции распределения электрического потенциала  $U(x)$  в темном катодном пространстве (ТКП). Квадратичная и линейная аппроксимации зависимости  $U(x)$ , используемые в [1-3], являются заведомо предельными случаями.

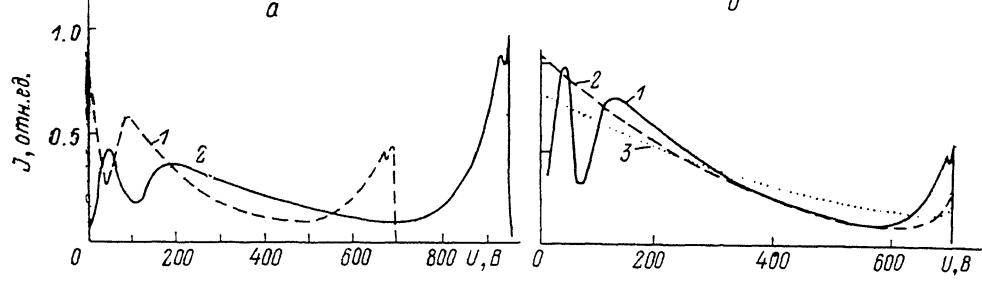


Рис. 1. Энергетические спектры ионов, бомбардирующих катод.

1 — экспериментальные результаты, 2 — первое слагаемое (1) с учетом зависимости  $\lambda(U)$ , 3 — то же при  $L/\lambda=3$ . Доля второго слагаемого (1) составляет 5 % от общего потока ионов.  $U_0$ , В: а — 700 (1), 950 (2), б — 700;  $j_0$ , А/м<sup>2</sup>: а — 1.3 (1), 4.4 (2); б — 4.2;  $P$ , Па: а — 11 (1, 2), б — 20;  $L$ , м: а —  $1.2 \cdot 10^{-2}$  (1),  $8 \cdot 10^{-3}$  (2), б —  $6 \cdot 10^{-3}$ .

Цель настоящей работы — определение энергетического распределения ионов на катоде планарной диодной распылительной системы с учетом более корректной зависимости  $U(x)$  и сравнение рассчитанных энергетических распределений ионов с экспериментально измеренными.

Энергии ионов измерялись как методом задерживающего потенциала, так и при помощи плоского электростатического зеркала. Разрешающая способность энергоанализаторов составляла 5 и 0.7 % соответственно. Анализируемый поток ионов выводился через отверстие в медном водоохлаждаемом катоде планарной диодной распылительной системы. Давление в аналитической камере не превышало  $5 \times 10^{-3}$  Па. Более подробное описание методики эксперимента приведено в работе [4].

Исследования проводились в режиме аномального тлеющего разряда: напряжение разряда  $U_0=70 \dots 1500$  В, плотность тока разряда  $j_0=0.4 \dots 6.0$  А/м<sup>2</sup>, давление аргона  $P=5 \dots 20$  Па. Длина ТКП измерялась визуально.